

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 6 月 2 日 (02.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/050318 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: G03F 7/004, 7/027, 7/028, H05K 3/06

[JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿 2 丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/016255

(72) 発明者; および

(22) 国際出願日: 2004 年 11 月 2 日 (02.11.2004)

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 沢辺 賢 (SAWABE, Ken) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki (JP). 頼 華子 (YORI, Hanako) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki (JP).

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特 願 2003-389836  
2003 年 11 月 19 日 (19.11.2003) JP

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目 1 0 番 6 号銀座ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

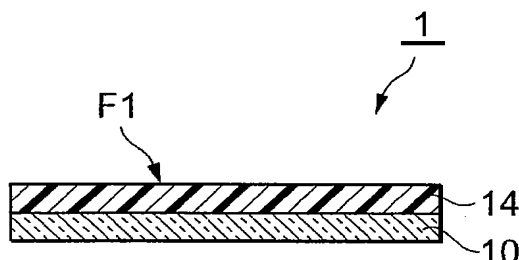
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.)

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

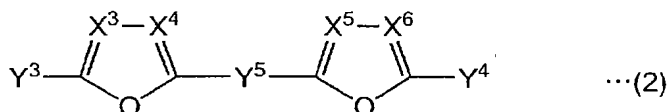
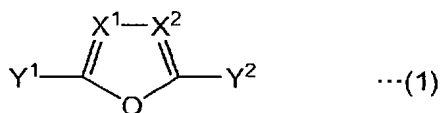
[続葉有]

(54) Title: PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, PHOTSENSITIVE ELEMENT, METHOD FOR FORMING RESIST PATTERN, AND METHOD FOR MANUFACTURING PRINTED CIRCUIT BOARD

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物、感光性エレメント、レジストパターンの形成方法及びプリント配線板の製造方法



(57) Abstract: Disclosed is a photosensitive resin composition containing (A) a binder polymer, (B) a photopolymerizable compound having an ethylenically unsaturated bond, (C) a photopolymerization initiator and (D) a compound represented by the following general formula (1) or (2): (1) (2) (wherein X<sup>1</sup>, X<sup>2</sup>, X<sup>3</sup>, X<sup>4</sup>, X<sup>5</sup> and X<sup>6</sup> independently represent a CH group, CCH<sub>3</sub> group, CC<sub>2</sub>H<sub>5</sub> group or nitrogen atom; Y<sup>1</sup>, Y<sup>2</sup>, Y<sup>3</sup> and Y<sup>4</sup> independently represent an aryl group which may have a substituent; and Y<sup>5</sup> represents an arylene group which may have a substituent).



[続葉有]

WO 2005/050318 A1



BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

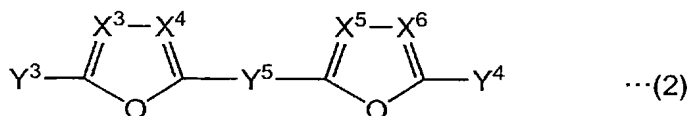
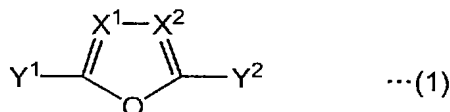
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

(A) バインダーポリマーと、(B) エチレン性不飽和結合を有する光重合性化合物と、(C) 光重合開始剤と、(D) 下記一般式(1)又は(2)で表される化合物と、を含有する感光性樹脂組成物。

【化1】



[式中、 $\text{X}^1$ 、 $\text{X}^2$ 、 $\text{X}^3$ 、 $\text{X}^4$ 、 $\text{X}^5$ 及び $\text{X}^6$ は、それぞれ独立に、CH基、 $\text{CCH}_3$ 基、 $\text{CC}_2\text{H}_5$ 基又は窒素原子を示し、 $\text{Y}^1$ 、 $\text{Y}^2$ 、 $\text{Y}^3$ 及び $\text{Y}^4$ は、それぞれ独立に、置換基を有していてもよいアリール基を示し、 $\text{Y}^5$ は置換基を有していてもよいアリーレン基を示す。]